

# 研究開発及び知的財産報告書 2004

2004年6月

株式会社日立製作所

## <目次>

ごあいさつ .....	1
I. はじめに .....	2
II. 日立グループ中期経営計画“i.e. HITACHI プラン II”と技術経営 .....	2
1. “i.e. HITACHI プラン”から“i.e. HITACHI プラン II”へ .....	2
2. “i.e. HITACHI プラン II”達成に向けた日立グループの技術経営 .....	3
3. 日立のグループ経営のさらなる深化を期して「グループ戦略本部」を新設 .....	6
III. 主要注力事業における研究開発、知的財産活動の状況 .....	7
1. 新時代のライフラインを支えるソリューションの例 .....	7
1.1 SAN/NASストレージソリューション事業 .....	7
1.2 ミューチップ応用ソリューション事業 .....	7
2. 高度技術グローバル製品の例 .....	8
2.1 ハードディスクドライブ事業 .....	8
2.2 オートモティブシステム事業 .....	9
IV. 研究開発 .....	10
1. 研究開発体制 .....	10
1.1 日立グループの研究開発組織の概況 .....	10
1.2 研究開発本部 .....	10
1.3 研究開発のグローバル展開 .....	10
2. 研究開発戦略 .....	11
3. グループR&Dの強化 .....	12
V. 知的財産 .....	13
1. 特許 .....	13
1.1 知財管理体制及びポートフォリオ状況 .....	13
1.2 特許戦略 .....	14
1.3 特許関連の訴訟への対応 .....	16
1.4 発明管理本部の新設 .....	16
2. ブランド .....	17
2.1 ブランド関連施策推進体制 .....	17
2.2 ブランド戦略 .....	17
参考1. 日米特許データ対象グループ会社リスト .....	20
参考2. 「特許行政年次報告書 2003年版」抜粋 .....	20
参考3. 主要社外表彰 .....	21

## ごあいさつ

日立グループは 2003 年度、計画を上回る業績を発表することが出来ました。ふりかえってみますと、昨年度は、新たな成長に向けた日立グループを育んだ年であったと思います。中期経営計画” i. e. HITACHI プラン II ” のスタート、事業ポートフォリオの再編成、委員会等設置会社への移行など、昨年度に実行した経営改革によって、新しい日立グループの姿が描けたと思います。しかし、今回の結果は、” i. e. HITACHI プラン II ” 達成という目標に向けた一通過点にしか過ぎません。ユビキタス時代の到来、市場のグローバル化など、ますます競争が激しくなりますが、こうした変化の時代こそ大きなチャンスと考え、さらなる成長に向けてグループ経営の深化に取り組んでまいります。

当グループは、情報通信システム、電子デバイス、電力・産業システム、デジタルメディア、高性能材料など広範な技術を有しており、この広範な分野での技術と知識を縦横無尽に駆使できる総合力が日立の強みであると考えます。当グループが有する技術を融合し、シナジーを発揮させることで、お客さまの「ベスト・ソリューション・パートナー」になりたいと考えております。

当グループでは、これまで株式会社日立製作所をはじめとする各上場会社において、アニュアルレポートや、有価証券報告書において財務情報を中心とする開示を行うとともに、事業戦略説明会などを定期的実施してまいりました。これらの機会を通じて「研究開発」や「知的財産（特許、ブランド）」についてもご説明してまいりましたが、このたび、これらをまとめてご報告させていただきたいと存じます。

本報告書では、お客さま、株主の皆様、投資家・アナリストの方々をはじめとする当社のステークホルダーの皆様へ向けて、当グループの研究開発の考え方、組織を説明し、研究開発の成果である知的財産の状況とその活用の考え方を報告致します。本報告書を通じて当グループの研究開発及び知的財産を重視した取り組みを皆様にご理解頂き、皆様と共に新しい時代に一歩を踏み出したいと考えております。



2004 年 6 月  
取締役 執行役社長

庄山悦考

## I. はじめに

本報告書は、当社及び主要グループ会社の技術経営とその要素である「研究開発」及び「知的財産（知的財産権、ブランド）」に関する情報を提供することを目的としています。

報告対象期間は2003年度（2003年4月1日から2004年3月31日）とし、一部、2004年度からの組織体制、新規施策などについても記載しています。

## II. 日立グループ中期経営計画“i. e. HITACHI プラン II”と技術経営

### 1. “i. e. HITACHI プラン” から “i. e. HITACHI プラン II” へ

当グループは2000年度より経営改革の方向、目標を明確にした中期経営計画“i. e. HITACHI プラン”（2000年度～2002年度）を策定し、その実現に取り組んできました。

“i. e. HITACHI プラン”では、「ベスト・ソリューション・パートナー」への変革を目指し、『ITと知(knowledge)で装備された「情報システムサービス」と「社会インフラシステム」、及びそれらを支える「基幹のハードウェア、ソフトウェア、高機能材料」を提供し、この分野でトータルソリューションを提供できるグローバルサプライヤー』を目指した経営改革を進めてまいりました。

現在推進中の中期経営計画“i. e. HITACHI プラン II”（2003年度～2005年度）では、この基本的な考え方をさらに推し進め、「ベスト・ソリューション・パートナー」に向けたさらなる変革を推進中です。具体的には、SE サービスに代表される「情報システムサービス」とエネルギーシステム等の「社会インフラシステム」をさらに強化・融合してい

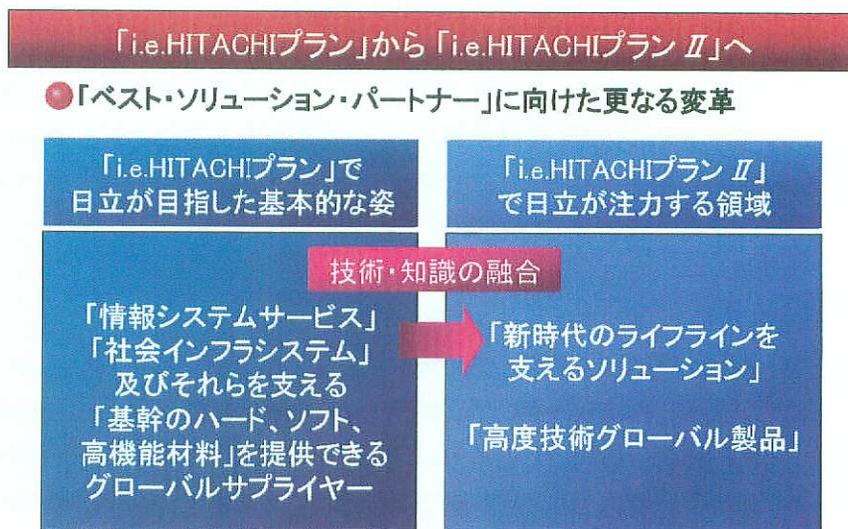


図 2.1 日立グループの経営ビジョン

く「新時代のライフラインを支えるソリューション」の領域と、当グループの高い技術・知識を集約した競争力のあるハードやソフトを中心にグローバル市場での高成長を目指す「高度技術グローバル製品」の両分野に経営資源を集中して注力事業を強化し、さらに両者のシナジーを發揮することで日立の総合力を活かした他社に差別化できる事業を展開していきます（図 2.1 参照）。

また、当グループでは、2003年6月に主要なグループ会社も含めて委員会等設置会社に移行しました。これにより各社における経営の迅速化と、当社から各社に社外取締役を派遣し当グループの一体運営の深化による経営効率の向上を推進しており、“i. e. HITACHI プラン II”の達成に向けて当グループの総力を挙げて取り組んでおります。

## 2. “i.e. HITACHI プラン II”達成に向けた日立グループの技術経営

“i.e. HITACHI プラン II”の実行（想定事業規模：2005年度連結売上高9兆円、連結営業利益4,000億円超）を通じてFIV<sup>1</sup>黒字化を実現するために、①グループ協創型 R&D の推進、②研究開発の効率向上、③Inspire A 事業に向けた技術開発の3つを柱として技術開発を推進していません。図2.2に当グループの技術経営体制を示します。

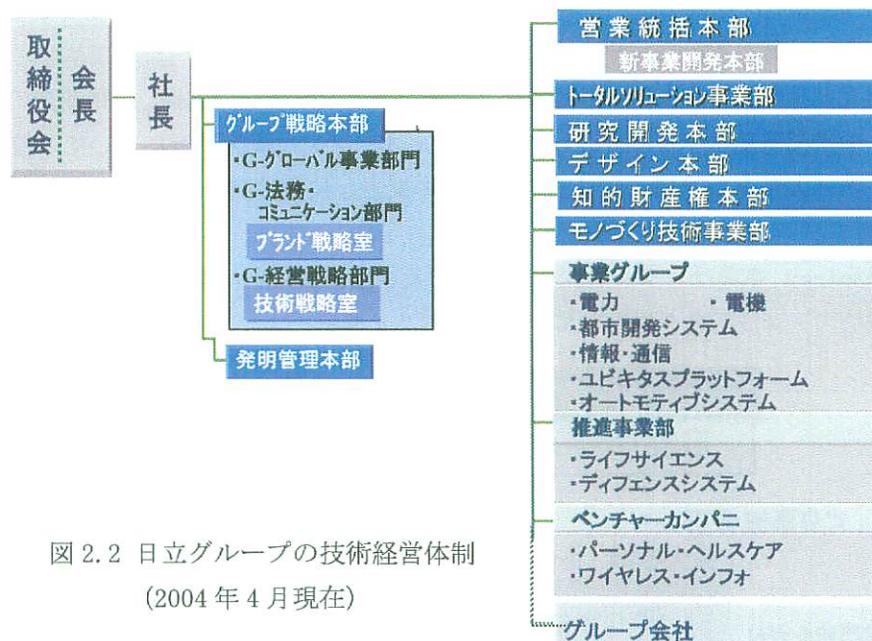


図 2.2 日立グループの技術経営体制  
(2004年4月現在)

グループ協創型 R&D の目的は当グループ技術の相互活用による研究開発力強化と技術の垂直統合による製品開発力強化です。これを実現するため、グループ先端・基盤研究制度を新たに設け、また、日立グループ CTO 会議（図 2.3 参照）を中心としてグループ全体に渡る技術開発戦略を策定、実行していきます。

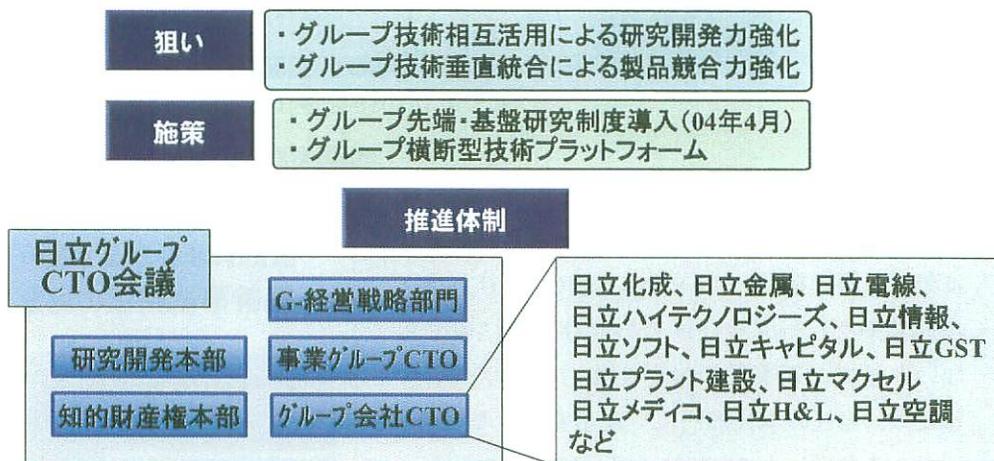


図 2.3 グループ協創型 R&D の狙いと推進体制

<sup>1</sup> Future Inspiration Value：税引後事業利益から資本コストを控除した経済的付加価値をベースにした日立独自の付加価値評価指標。黒字化を実現するためには、資本コストを上回る収益が必要。

グループ先端研究は、現在の事業分野にとらわれない将来の中核事業の開拓、パラダイムシフトを起こす新技術・新事業モデルの開発と知財化を目的とするものです。グループ基盤研究は、生産性向上、信頼性の改善、開発期間の短縮、モノづくり基盤技術の高度化を目的としています。この新研究制度により当グループ内での協創型の技術開発を推進しますが、特に重点分野として材料研究所、及び計測、シミュレーション、組込みソフトに関する3つのセンタを新たに設置しました。

研究開発の効率向上は、経営戦略と技術開発との整合性の確保、技術開発の選択と集中、オープンな研究開発を中心に推進します。特に、オープンな研究開発については包括提携を中心とした国内外大学との連携により技術シーズの探索と技術開発を効率良く推進することを狙っています。

Inspire A 事業は当グループの成長を担う中核事業の創出を目的とし、グループ一体となった事業拡大・育成活動を推進しています（図 2.4 参照）。



図 2.4 Inspire A 事業

当グループ中核分野として、ストレージから電池までの9分野を制定し、技術開発もこれら分野に集中と選択を図っています。特に、当社事業グループやグループ会社単独の既存事業に収まらないタイプの新事業の推進を強力にサポートするため、当社の本社部門に「新事業創生委員会」（図 2.5 参照）を2003年4月に設置しました。本委員会は、いわゆる死の谷の克服に向けて、顧客志向の立場から支援・事業化推進を進めております。

2002年1月には、当グループの技術戦略を横断

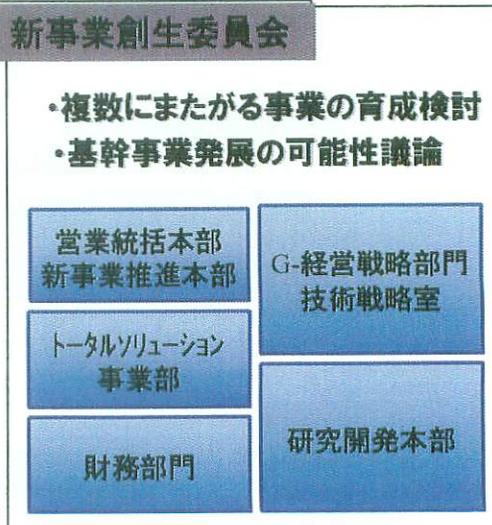


図 2.5 新事業創生の推進体制

的に立案、技術ポートフォリオを最適に管理する組織として、当社本社部門に技術戦略室を設置し、この技術戦略室を中心にグループ内のシナジーの創出・最大化に向けた諸施策を進めております。2002年3月には日立グループ技術戦略会議（現、日立グループCTO会議）を創設し、技術情報・ナレッジ共有化の推進や、グループ一体となった事業拡大・新事業育成に関する議論の場として活動中です。当グループでは、当社各事業グループ、グループ会社毎にCTO（最高技術責任者、Chief Technical Officer）を置き、所属する事業部門の技術ビジョンの策定と技術ポートフォリオ管理を行うとともに、前述の日立グループCTO会議のメンバーとして他部門・グループ会社との協力、グループ全体戦略の策定等を推進しております。

前述のInspireA事業の推進を通じた注力基幹事業の強化と新事業の創生のほか、中長期技術戦略の強化、技術開発基盤の整備（知的財産、全社生産性向上運動など）、先端技術研究の推進、および社外連携による強化を進めております。

中長期技術戦略の強化施策については、(1)研究開発部門による技術潮流予測と技術開発長期計画の策定と、(2)この技術開発長期計画をにらんだ事業部門による事業戦略ロードマップの策定、および(3)両者の策定段階における議論を通して、従来より長期レンジでの事業戦略と研究戦略の整合を図り、特に事業に直結する研究開発の効率の向上に努めております。

技術開発基盤の整備としては、知的財産活動（V章で詳述）の他、生産性向上運動として、特に製品開発力強化活動（HiSPEED/Next）を全社的に展開し、「モノづくり」基盤力の再整備と強化に取り組んでおります。

社外との連携強化では、産学官連携の強化やコーポレートベンチャーキャピタル制度の活用等により、事業拡大、新事業創生に向けた様々な取り組みを推進しております。

知的財産活動においては、主要グループ会社と知的財産戦略のあるべき方向性を共有し、出願のグローバル化、知的財産権本部海外拠点、知財専門家の共通利用化などの施策の共有化を推進しており、グループ全体としてのシナジー創出を追求しております。特に重要な技術については、グループ各社と連携を図ることにより、各社の保有する特許を束ね、一体化したグループ特許ポートフォリオとして活用をすることで、グループとしての知的財産戦略をさらに深化してまいります。

さらに当グループでは、HITACHIブランド自体が重要な経営資源、知的財産であることを認識し、2000年4月よりグループ連結として企業価値を高め、21世紀を代表する企業グループとして躍進するため、ブランドマネジメント強化に取り組んでおります。2002年4月には、経営・事業にブランドの視点を組込み、さらにブランド価値に沿った社員の一貫した行動促進のため、当グループ全体のブランドマネジメント専門組織としてブランド戦略室を設置し、経営戦略、事業戦略との連携強化を図っております。

“i.e. HITACHI プラン II”では、「信頼性」「技術力」などの従来のブランド価値に加え、ブランドプラットフォームである「Inspire the Next」に沿って「新たな時代に息吹を与え続ける」という姿勢を展開することで、お客様に対する新たなHITACHIブランドの価値向上をめざし、具体的計画を策定・実行しています。具体的には、研究開発、営業活動、コミュニケーション活動等のあらゆる機会を通じて、一貫したメッセージとしてお客様にご理解頂けるよう、グループ会社における視覚表現統一基準の制定やWebでの当グループとして統一感のあるデザインとコンテンツのマネジメント等を強化しています。

### 3. 日立のグループ経営のさらなる深化を期して「グループ戦略本部」を新設

当社は、中期経営計画“i. e. HITACHI プラン II”に基づき、連結ベースでの経営改革を推進していますが、このたび4月1日付で、グループシナジーの拡大など当グループの総合力発揮を目指した経営戦略の構築と実行を行う組織として、「グループ戦略本部」を設置しました。

「グループ戦略本部」の本部長には、日立化成工業株式会社の内々崎功会長が、日立の「グループ経営執行役」として就任しました。また、「グループ戦略本部」は、「G-グローバル事業部門」、「G-法務・コミュニケーション部門」、「G-経営戦略部門」からなり、グループの経営戦略の構築と実行にあたります。(図2.2参照)

今後、グローバル企業として、グループの永続的な発展を目指し、「グループ戦略本部」を新設し、企業価値を継続的に向上させる施策を、集中的に立案、提言、実行するとともに、グループシナジーを徹底して追及していきます。

「グループ戦略本部」においては、グループ会社ならびに日立の各事業グループの人材を投入するとともに、日立とグループ会社との間で人材交流を図っています。これにより、「グループ戦略本部」が当グループ全体の視点に立って、グループ経営の充実を図る体制が構築されることとなります。

今回の「グループ戦略本部」の新設は、「自主独創の精神」を尊重しつつ、「意思ある統合経営」を深化させ、日立らしいグループ経営を加速させるものです。こうした取り組みを通じ、“i. e. HITACHI プラン II”の目標である2005年度FIVの黒字化、さらに、その先の当グループの成長に向け、当グループの総合力を十分に発揮していきます。

### Ⅲ. 主要注力事業における研究開発、知的財産活動の状況

本章では、前章で述べた “i.e. HITACHI プラン II” における諸施策の取り組み状況を、主要注力事業の具体例にてご説明します。

#### 1. 新時代のライフラインを支えるソリューションの例

##### 1.1 SAN/NASストレージソリューション事業

インターネット技術の進展に伴い、いつ、どこにいても世界中の情報へアクセスできるユビキタスコンピューティング環境が急速に整備されています。そのような流れの中で、データセンタでは膨大なデータの戦略的な活用とストレージの運用・管理の効率化が求められています。これらのニーズに確実に応えるため、国内外で高いシェアをもつディスクアレイサブシステムに国内でトップクラスの実績をもつシステム運用管理技術を活用したストレージ管理ソフトウェアを組み合わせることによって、ストレージソリューションを強化していきます。また、海外パートナー企業との戦略的なアライアンスを通じて、グローバル市場でのさらなる事業強化を進め、リーディングカンパニーとしてグローバル市場を牽引してまいります。

知的財産活動の状況は、たとえば米国特許出願件数が、2003年度までの累計で約800件となっており、今後も特許ポートフォリオの充実を図ってまいります。ブランドの面では、国内向けには、SANRISE (サンライズ) の統一製品ブランド名で、日立のサービス



図 3.1 大型ディスクアレイサブシステム

プラットフォームコンセプト「Harmonious Computing (ハーモニアス・コンピューティング)」の下に、統合的なブランド戦略を進めており、また、海外においても、日立データシステムズ社を中心にして世界170ヶ国以上の国に対してストレージ・ソリューションを提供しております。

※SAN: Storage Area Network の略。磁気ディスクや磁気テープなどのストレージ機器を LAN から切り離して、高速通信技術であるファイバーチャネルで接続したストレージ専用のネットワーク。

NAS: Network Attached Storage の略。LAN に直接接続する形式のストレージ機器で、ファイルサーバーとしての機能に特化した専用機。

##### 1.2 ミューチップ応用ソリューション事業

キーデバイスである「ミューチップ」は、チップサイズが0.4mm角という世界最小クラスの無線自動認識 IC チップで、特に、紙にも埋め込むことが可能なその小ささと高いセキュリティ機能を活かしたソリューションとして、既に愛知万博の入場券や来場者管理などの分野で採用されています。さらに、製品のサプライチェーン、品質管理、安全管理、偽造防止など、新

たなビジネスモデルを構築して市場を創出しつつあります。本事業部門は、2004年1月に社内ベンチャーカンパニーから事業部となり、更なる事業拡大をめざしております。

知的財産活動の状況は、重要技術の目安となる外国特許出願件数は、研究開発開始から2003年度まで約130件の米国への特許出願を行っており、特許ポートフォリオの拡大を図っております。マスコミや各界からもご注目いただき、「2003年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞(日本経済新聞賞)」（日本経済新聞社主催）、「2003年日刊工業新聞十大新製品賞増田賞(最優秀賞)」（日刊工業新聞主催）、「第9回LSIデザイン・オブ・ザ・イヤー:デバイス部門グランプリ受賞」（半導体産業新聞主催）、「第13回日経BP技術賞(電子部門)部門賞受賞(日経BP社主催など、多数受賞しております)。



図 3.2 ミューチップ

## 2. 高度技術グローバル製品の例

### 2.1 ハードディスクドライブ事業

増加の一途をたどる情報量に対応するため、ハードディスクドライブ(以下、HDD)の重要性はますます大きくなっております。また、HDDは、前述の日立の提供するSAN/NASストレージソリューションを支えるキーコンポーネントであり、今後とも「新時代のライフラインを支えるソリューション」へと幅広く展開されていきます。小型HDD分野からサーバ分野まで製品ラインナップの充実による戦略的な強化を進めてまいります。

今後のHDDに対する大容量化、小型化の要求に対して、日立グローバルストレージテクノロジーズ社(以下、日立GST)、および当グループは、磁性薄膜技術、微細パターン形成技術、ヘッド形成技術等の多くの強み技術を保有しております。今後も、これら強み技術にさらに磨きをかけ、競争力のある新製品を開発投入していく予定です。(図3.3は1.0型HDD(幅42.8mm×奥行36.4mm×厚さ5.0mm))

知的財産活動の状況は、HDD分野での世界No.1の特許網構築をめざし、日立GSTでは米国出願の強化を図っており、2003年の米国特許登録件数は279件でしたが、増強の成果が現れはじめる2006年ころま

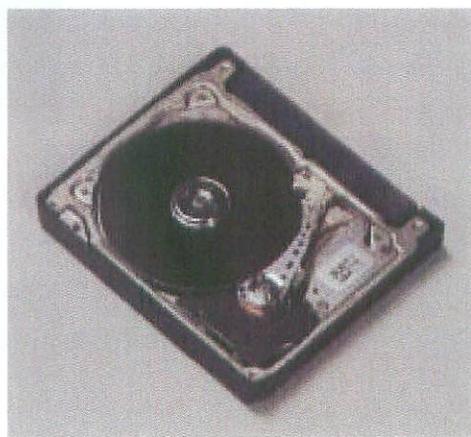


図 3.3 1.0型HDD(ほぼ実寸大)

では倍以上の登録件数を見込んでおります。また、垂直磁気記録については、外国特許出願件数が研究開発開始から2003年度までの累計で約110件(米国)であり、これらを核とした特許ポートフォリオの構築を推進中です。ブランドの面では、「HDDをキーコンポーネントとして、日立はユビキタス情報社会を構築する」ことをお客様、ビジネスパートナーの方々にご理解頂けるように、グローバルな宣伝広報活動を展開しております。たとえば、2003年秋には、市場として今後大きな成長が見込まれる北米、中国、日本で、新聞、雑誌等を通じた広告宣伝キャンペーンを実施するなど、今後も日立GSTと連携しながら、HDD市場におけるHITACHIブランドのプレゼンス向上を戦略的に進めていく予定です。

## 2.2 オートモティブシステム事業

今後さらに加速する環境規制強化に対応し、2006年以降に本格的な立ち上がりが期待されるエレクトリックパワートレインをはじめとして、将来的に大きな伸長が期待できる事業分野であると考えております。また単なる部品事業にとどまらず、テレマティクスを含む車載情報システムソリューションなどグループ横断的な取り組みも推進中です。

当社及びグループ会社では、従来より、大型電気機器で培ったインバータ技術、高効率モータ技術、高出力二次電池技術など多くの関連技術を保有しており、これら技術を、特にエレクトリックパワートレイン機器などに適用することによって、他社にない強みとなる技術の創出ができるものと考えております。

知的財産活動の状況は、エレクトリックパワートレイン関連では、米国特許出願件数が2003年度で45件となっており、これまで出願したものとあわせ、これらを核とした特許ポートフォリオの構築とさらなる

強化を図っております。ブランドの面では、「人・クルマ・社会」に新たな価値を創造し、夢を実現する企業をめざす”を理念に、日立の多岐にわたる総合力を結集したオートモティブシステム事業の認知を高めるための施策を展開しております。

また、株式会社日立製作所、トキコ株式会社(以下トキコ)、株式会社日立ユニシアオートモティブ(以下ユニシア)の3社は、環境・安全分野におけるオートモティブシステム事業の強化を目的とした合併に合意し、2004年5月、合併契約書を締結しました。合併期日は2004年10月1日の予定です。合併により、トキコのサスペンションシステムやブレーキシステム技術、ユニシアのステアリングシステムやシャシー(車台)制御技術など世界トップレベルの技術を融合して、電動ブレーキ、走行制御系システムにおいても先行開発・製品化を一段と加速させることが可能となります。

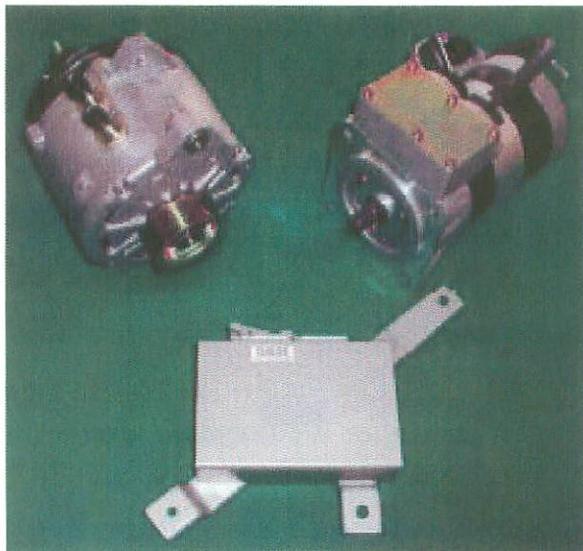


図 3.4 バッテリーレス電動4WDシステム

## IV. 研究開発

### 1. 研究開発体制

#### 1.1 日立グループの研究開発組織の概況

当社には、前述のようにグループ技術戦略を統括する「技術戦略室」があります。当社内の事業グループ、グループ会社は、それぞれのビジネス戦略にもとづき、製品直結の開発を担当する開発部門をもっています。一部のグループ会社は独自の研究所組織を持ち、グループ内には合わせて30の研究所があります。これらの組織では、5,340人が研究開発に従事しています(2003年度、連結)。

研究開発部門の費用をはじめとする当グループの研究開発費は、2003年度において3,718億円(連結)であり、対売上高比率は4.3%となっています。また、2004年度は2003年度に対して5%増の3,900億円(4.4%)を見込んでいます。

#### 1.2 研究開発本部

当社のコーポレート研究開発組織である研究開発本部では、6つのコーポレート研究所において2,820人が研究開発に従事しています(図4.1参照)。研究開発本部における研究開発費は2003年度において約626億円です。

## 研究開発の組織と概要

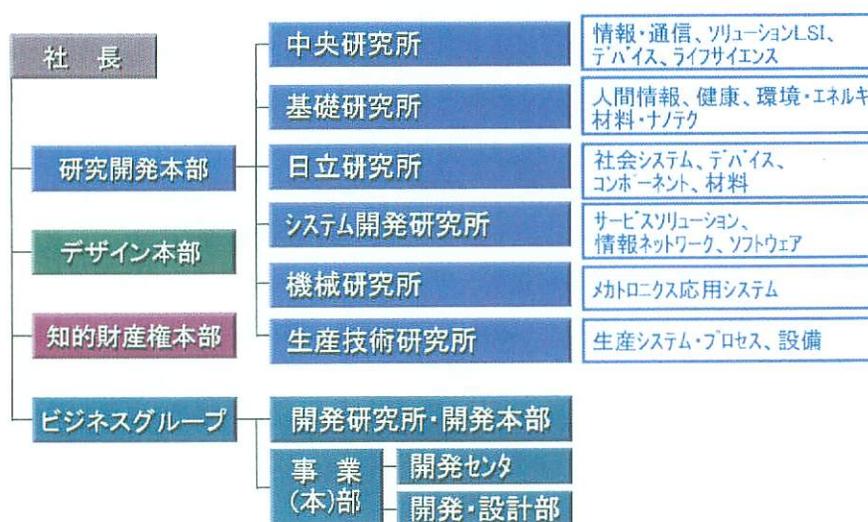


図4.1 日立の研究開発組織

#### 1.3 研究開発のグローバル展開

日立は、グローバル事業展開の支援、グローバル市場における新事業創出を目指し、1989年に米国、および、欧州に研究開発拠点を設立しました。また、2000年には、今後大きな伸びが期待できる中国市場にむけた研究開発を行うため、日立(中国)投資有限公司内に研究開発センターを設立し、三極体制を確立しました(図4.2参照)。

## 研究開発の国際展開

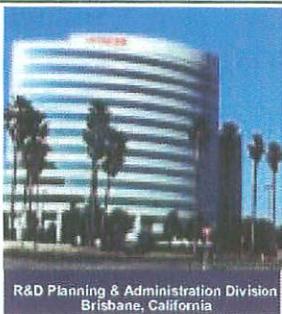
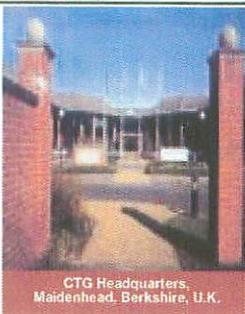
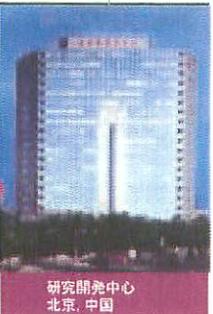
	●北 米			●欧 州		●中 国	
進め方	先端市場にむけた開発推進/現地事業拡大			現地大学研究機関・企業との協同		現地顧客にむけた研究開発	
組織	Hitachi America, Ltd./ Research & Development Division			Hitachi Europe Ltd./ Corporate Technology Group		Hitachi (China) Investment, Ltd./ Research & Development Center	
分野	半導体ソフト	情報・ネット ワーク	自動車機器	先端デバイス	情報・モバイル バイオ	ユビキタスIT	情報サービス
場所	サンノゼ	サンタクララ	デトロイト	ケンブリッジ (英)	ダブリン(アイルランド)・ ソフィア(ブルガリア)	北京	上海
							
	R&D Planning & Administration Division Brisbane, California			CTG Headquarters, Maidenhead, Berkshire, U.K.		研究開発中心 北京, 中国	

図4.2 グローバルR&D

米国の開発拠点は、サンノゼ（モバイル機器向け SH-DSP）、サンタクララ（情報ネットワーク）、デトロイト（自動車関連デバイス）などです。

欧州では、英/ケンブリッジ（量子効果デバイス、量子情報処理）、仏/ソフィア・アンティポリス（ユビキタスコンピューティング）、アイルランド/トリニティカレッジ（バイオインフォマティクス）、伊/ミラノ（デザイン）などに研究組織があります。

日立(中国)投資有限公司・研究開発中心では、中国市場向け空調機器の開発、移動通信関連の技術調査から活動を開始しました。さらに2002年10月にはユビキタスIT関連技術の共同研究のため、実験室を清華大キャンパス内に設置しました。今後、IPv6ネットワーク、携帯端末などの情報通信関連を中心に研究人員を増強する予定です。さらに、アジアにおける研究開発を強化するため、2004年4月にシンガポールに拠点を設置しました。ストレージ分野を中心に大学等との研究協力を推進していく予定です。

## 2. 研究開発戦略

当社研究開発本部は、事業戦略と技術戦略の整合性を持ち連結経営強化に対応するよう「グループ全体の全社研究所」と位置づけられ、従来の「当社だけの全社研究所」から発展を図っています。以下に、研究開発本部の運営の状況を示します。

研究開発本部では、将来の事業を担う技術開発を行っており、特に、“i. e. HITACHI プラン II”の注力事業分野へは研究開発人員を集中し、高度グローバル製品を支える圧倒的に強い技術の開発と、新時代のライフラインを支えるソリューションを創出する市場直結型R&Dを推進しています。

研究開発本部は、これらのR&Dの活動がいかに環境に影響を及ぼすかを十分認識し、環境との調和を最優先課題の一つとしてとらえています。そこで、環境マネジメントシステムを研究開発本部内に構築して全従業員参加のもと、循環型社会形成のため、環境保全活動の推進・維持向上に努め、継続的改善を図っています。特に、単にR&D活動における環境影響負荷の低減に努める

だけではなく、鉛フリーはんだ接続技術、燃料電池、ハイブリッド自動車用駆動システムなど、地球環境問題解決に関するニーズを的確に把握し、これに対応する環境影響負荷の少ない製品、環境保全に寄与する製品の研究開発を通じ循環型社会に貢献することを目指しています。これまでは、各研究所ごとに ISO 14001 の認証を受けておりましたが、2003 年より研究開発本部全体を対象とした認証を受けております。

研究開発本部の大きなミッションの一つが新事業の創生です。その具体的事例として、最近では、次の組織が研究所主体で新事業部門として生まれています。今後も、ベンチャーカンパニーを積極的に設置する方針で進めます。

- ライフサイエンス推進事業部(1999年10月設立)
- ミューソリユーションベンチャーカンパニー (2001年7月設立、2004年1月よりミューソリユーション事業部)
- パーソナルヘルスケアベンチャーカンパニー(2002年9月設立)
- ワイヤレスインフォベンチャーカンパニー(2004年1月設立)

### 3. グループR&Dの強化

日立では、グループR&Dをさらに強化するために、2004年4月より新しい研究開発制度「グループ先端・基盤研究制度」を導入いたしました。この制度は、当社、および、当グループ各社が同じ条件で研究開発費を負担し、当グループの将来事業の開発（先端研究）と、グループ共通基盤技術の強化（基盤研究）を行うものです。この研究開発では、パラダイムシフトを起こす新技術・新事業モデルの開発と知財化により、当グループの将来の中核事業開拓、当グループのモノづくり力の強化を目指します。先端研究、基盤研究の成果として生み出された特許は、当社が所有管理し、グループ先端、基盤研究制度に参画するグループ各社は当該特許を無償で実施することが出来ます。

先端研究では、基礎研究所を推進の中核組織と位置づけます。産学官連携を含め外部の研究組織との協力も積極的に推進します。また、研究開発の内容に応じて、中央研究所をはじめとする適切な研究所が研究開発を担当します。

基盤研究では、生産技術研究所を中心に、日立研究所、機械研究所、システム開発研究所が「モノづくり」（いわゆる製品製造技術だけではなく、企画・設計などの上流工程、および、ソフトウェア開発を含めた、広い意味での、製品・サービスの生産性）を強化する研究開発に取り組みます。当社のモノづくり技術強化を担当するモノづくり技術事業部とも協力して、当グループの製品競争力の強化に努めます。

また、当グループの研究開発者を集結し、グループ研究開発資源を最大化するために、「グループ横断型研究開発プラットフォーム」を2004年4月に立ち上げました。具体的には、材料研究所、高度計測センタ、高度設計シミュレーションセンタ、組込みソフト基盤技術センタの4組織です。材料研究所では、ナノテク・材料技術をベースに No.1 新製品・新技術の開発を目指します。高度計測センタでは、極限計測技術の高度化と設備の先端化を図ります。高度設計シミュレーションセンタでは、研究グリッドを活用し、高度シミュレーション環境を構築します。組込みソフト基盤技術センタでは、組込みソフトを中心としたソフト標準開発プロセスを確立します。

## V. 知的財産

### 1. 特許

#### 1.1 知財管理体制及びポートフォリオ状況

##### 1.1.1 知的財産権本部

当社の知的財産権本部では、特許・意匠取得の主体である IP 開発本部は製品技術別に 9 部門を 7 拠点に配置し、研究開発に密着した活動体制を取っております。IP 開発本部は約 200 名の特許技術者を擁し、うち有資格者（弁理士）も 54 名（2004 年 3 月時点）となっております（図 5.1 参照）。

また、商標部門、著作権部門を含め、特許活用の主体である特許ライセンス部門を要する IP ビジネス本部、並びに本社スタッフ部門と合わせて約 100 名が本社に配置されております。知的財産権本部では理念として「知的付加価値の創造」を掲げ、グループ事業への貢献を目指しています。特許料収入、グループ事業への貢献等の期待できる発明を選択し、リソースを集中しています。

また、グループ会社とは、日立グループ知財連絡会議を通じて当社と連携をしながら知財活動を行っております。

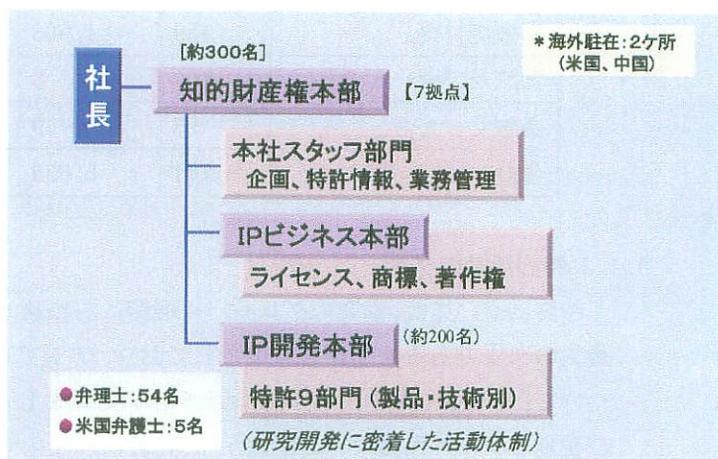


図 5.1 知的財産権本部の組織

##### 1.1.2 特許ポートフォリオの現状

当社単独での米国特許の登録件数は、ここ数年の出願強化により 2003 年の登録数ランキングは第 3 位となっております（米国 IFI 社<sup>1</sup> 調べ、表 5.1 参照）。表 5.1 2003 米国登録数ランキング

2004 年以降は、分社化の進展等の事業再編によりグループ会社名義の登録となる関係で、当社単独名義での米国特許登録数は減少することになりますが、グループ全体として引続き上位の水準を確保してまいります。

尚、2003 年の当社単独及びグループ会社の日本公開特許数、米国特許登録数は表 5.2<sup>2</sup>のとおりです。

順位	企業名	米国登録件数
1	IBM	3,439
2	キヤノン	1,997
3	日立	1,906
4	松下電器	1,821
5	HP	1,763

<sup>1</sup> IFI CLAIMS' Patent Services 社：米国特許情報提供会社。http://www.ificlaims.com

<sup>2</sup> 下記データベースを用いて当社にて調査（調査範囲は 2003/1/1～12/31）。調査対象グループ会社については巻末の参考 1 を参照。当社分については、IPC 分類に基づいて各部門へ配分。グループ会社と当社との共同出願は、当社分に算入。グループ会社同士の（当社を出願人として含まない）共同出願は重複カウントあり。  
〈調査データベース〉

- ・ 日本公開特許（公開、公表、再公表）：PATOLIS [調査時点 2004/5/12]
- ・ 米国特許登録数：IFIPAT/Questel-Orbit [調査時点 2004/5/13]

表 5.2 2003 年日本公開特許数、米国特許登録数

部門	2003 年日本公開特許数			2003 年米国特許登録数		
	日立製作所	グループ会社	小計	日立製作所	グループ会社	小計
情報通信システム	1,852	784	2,636	543	85	628
電子デバイス	1,147	751	1,898	744	54	798
電力・産業システム	1,540	2,050	3,590	356	139	495
デジタルメディア・民生機器	909	1,130	2,039	221	39	260
高機能材料	159	1,908	2,067	41	79	120
物流及びサービス他	109	6	115	2	12	14
金融サービス	58	9	67	2	0	2
合計	5,774	6,638	12,412	1,909	408	2,317

1.1.3 特許活動のグローバル化

特許については、事業のグローバル展開にあわせてグローバル化が急務です。出願国としては、最大の市場である米国を最も重視しており、アジアと欧州がほぼ同数となっています。アジアについては、従来、韓国と台湾が大半を占めていましたが、他国への模倣品輸出の抜本的対策、及び現地ビジネス保護などの観点から、特許のみならず意匠についても現在中国出願を強化中です。

1.2 特許戦略

当社は、「他社に勝つ」という強い意思を共通認識とした、事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略との三位一体活動を行っており、知的財産権本部より方針を提案・承認を得ることで全体戦略がトップダウンにて策定されます。これを事業グループ単位、さらにはその傘下の本部・部単位の活動に展開しています。特に、特許活動においては、事業分野毎に特許戦略会議を定期的に行い、事業グループ単位の方針決定と特許活動状況のフォローアップを行っています。また、マーケットニーズによっては、複数の事業所・グループ会社を横断するビジネスがあるので、横断プロジェクト活動も行っています。

今後、IV. 3 で述べたグループ先端・基盤研究制度の研究成果として生み出された特許は、当社が所有管理し、同制度に参画するグループ各社で当該特許を無償で実施することが出来ます。また、活用にはグループの特許ポートフォリオとして、戦略的に活用してまいります（図 5.2 参照）。

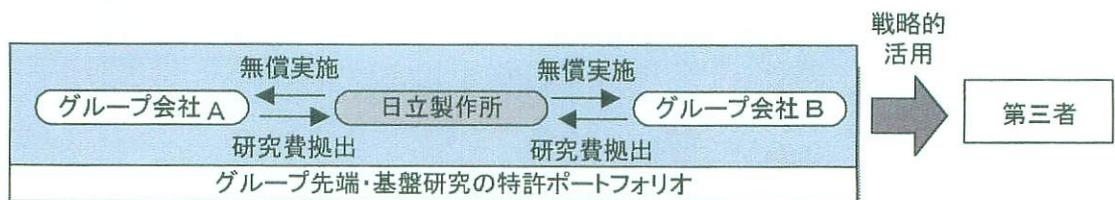


図 5.2 グループ先端・基盤研究の特許ポートフォリオ

1.2.1 特許取得

知的財産権本部は、研究開発本部や各事業グループなどの発明部門から生まれた発明をブラッ

シユアアップすることで、知的付加価値を有し、事業活動に貢献する特許に仕上げる活動を行なっております。その活動は発明の創生活動、発明の育成活動の2段階に分けられます。

発明創生段階では、研究・開発の初期段階から組織的に多分野の知恵を集め、深く検討をすることにより、発明を多角的な視点からとらえることに主眼をおいてブラッシュアップしています。特に、当社の強み技術、差別化技術に関しては、「フラグシップ特許活動」を通じて、当該技術の特許ポートフォリオの核となるような強い特許を創生しています。

発明育成段階では、出願後の技術動向及び事業計画を考慮しながら出願済みの発明をさらにブラッシュアップしています。

特に、当社の強み技術、差別化技術に

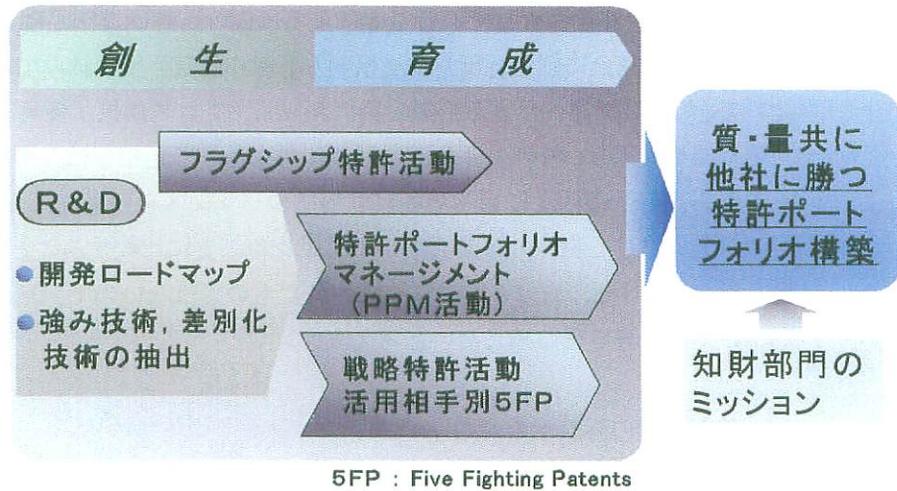


図 5.3 特許ポートフォリオの構築

関しては、「フラグシップ特許活動」を通じて創生した出願を核に、「特許ポートフォリオマネージメント活動」により、他社に勝つ特許ポートフォリオの構築を図っております(図 5.3 参照)。

通常の育成活動に加えて、個々の特許単位での施策としては、一つの製品分野で特許侵害訴訟に耐え得る特許を少なくとも5件取得しようとする「5FP (Five Fighting Patents) 活動」を展開しております。また、現在又は将来の主要技術に関する基本的・必然的発明の特許出願に関し、早期に「金」(他社が回避することがきわめて困難なもので、世界トップレベルの基本発明)、「銀」(他社が回避することがきわめて困難なもので、国内トップレベルの発明)、「銅」(他社が回避することが困難なもので、当社の主要製品のセールスポイントとして積極的に活用する発明)というフラグを立て重点的に特許取得する「戦略特許活動」も行っております。

### 1.2.2 特許活用

当社においては、「事業活動への貢献」を目的として特許の活用を図っており、貢献形態の代表的なものは、①特許料収入 (キャッシュフローへの貢献)、②クロス効果 (クロスライセンス契約締結による設計自由度の確保への貢献、及び、特許料支払い低減への貢献)、③多角的活用 (お客様による当社特許の価値の認定によって得られた受注への貢献、当社が高いシェアを持つ分野については、独占的立場を守るために特許を独占排他的に用いるライセンス拒否、アライアンス支援への貢献など) です。特許については、量から質の時代を経て、今後は戦略の時代と認識しており、技術別、製品別に上記貢献形態を効果的に使い分け、戦略的に活用をしていきます。

技術料(特許及びノウハウのライセンス料)については、1970年に保有権利の有償開放制度を採用して以来、収支の改善を進め、1985年に収支の黒字転換以来、着実に黒字を維持・拡大しています。

なお、「特許行政年次報告書 2003年版」(特許庁)において、企業における知的財産の取得・

管理の実施例として、当社は「知的財産エクセレントカンパニー」として紹介されております(巻末の参考2参照)。

### 1.2.3 特許価値評価と社内管理指標への適用について

特許に関する情報の開示において、特に、保有する特許の価値を明らかにする旨の要請がありますが、(特許を保有していることによる価値の)評価方法が確立していないのが現状です。そこで、当社独自に価値評価方法を検討し、特許価値評価を試みております。この評価方法に基づいて、1.2.2で述べた貢献形態(特許料収入、クロス効果、多角的活用)毎の効果を表す社内管理指標を導入し、特許の多角的な活用に供するべく運用をはじめました。この指標により、個々の事業(技術・製品)に適した各貢献形態のバランスを効果的に管理することができ、また、個々の事業における特許の事業活動への貢献を年ごとに比較することができます。

尚、上記評価方法は客観的に確立されたものではないので、上記評価方法及び価値評価結果については公表を差し控えたいと考えます。

### 1.3 特許関連の訴訟への対応

当社は1910年の創業当初より各工場毎に報奨規程を定め、1941年には全社統一の報奨規程を制定し、「技術の日立」に相応しい発明者への報奨・表彰制度とすべく、数年毎に見直しをしてまいりました。報奨制度は特許法35条に対応した発明者への対価的性格のものであり、表彰制度は、発明者のみならず、知的財産権部門、事業部門の関係者のインセンティブを高める性格のものであります。報奨・表彰金の総額は年間約7億円であり、10年間の累積で、1000万円以上の受取者が30名以上おり、支払い総額とも他社と比較して遜色のない制度です。

当社が被告である特許報奨金請求訴訟に関する東京高裁判決(原告元従業員米澤氏へ約1.6億円の支払い判決)が2004年1月29日に出ましたが、2004年2月10日に最高裁へ上告をいたしました。本件に関しても、当社は金額的にみても他社と比較して遜色ない報奨規定に基づき、適正な運用を行ったものと考えております。

### 1.4 発明管理本部の新設

社長直属の組織として発明管理本部を2004年3月1日付で新設しました(技術経営体制における位置付けは図2.2参照)。

同本部は、研究開発、知的財産、法務、人材、広報などの担当者13名から構成される組織です。研究開発における知的財産管理のあり方の検討、従業者発明制度についての諸外国の取扱いの研究等を通じて、発明の適切な取扱いを実行し、研究開発を促進していくことが設立の目的です。

## 2. ブランド

### 2.1 ブランド関連施策推進体制

当グループのブランドマネジメントについては、グループ戦略本部ブランド戦略室で担当しております。また、各ビジネスグループおよび各グループ会社には、ブランド推進責任者を配置し、ブランド戦略室との緊密な連携により、各種ブランド施策を展開しています。

当グループのコーポレートブランドである「日立ロゴ」"HITACHI"、「日立マーク」、「日立」は、当社知的財産権本部が、全世界の商標の権利取得・保護について一元管理しています。（世界約200ヶ国において、当グループ各社の商品・サービス分野で商標を約7,000件登録しています。）各プロダクトブランドは、当社並びに各グループ会社の知財部門が、商標の権利取得・保護について管理しています。

HITACHIブランドの商標の保護活動として、家電品、自動車部品、電子部品、電動工具等の模倣品対策を中国、アジア、中近東、アフリカ等で積極的に取り組んでいます。特に中国では侵害差止、刑事訴訟等で成果を上げており、現地法人の知的財産権部門等と協力して、現地での模倣品対策を鋭意推進しています。

### 2.2 ブランド戦略

「情報化社会」から「知識社会」へ、さらに経営のグローバル化が進む今日、当グループ統一ブランドであるHITACHIブランドをグループの連結環として、企業価値を高め、21世紀を代表する企業グループとして躍進するため、当グループでは2000年4月よりブランドマネジメントに取り組んでいます。コーポレートステートメント「Inspire the Next」は、日立の意思と、製品やサービス、システムを通じて日立が世の中に提供する価値を表現した言葉であり、豊かな社会生活とよりよい社会の実現のために、日立は「次なる時代に息吹を与え続ける」という意味が込められています。現在、推進中の主な内容は以下の通りです。

#### (1) 中期経営計画“i.e. HITACHI プラン II”に基づくブランドマネジメント推進計画の策定

各事業グループ及びグループ各社は、HITACHIブランドの持つ「信頼性」「技術力」などの価値、「次なる時代に息吹を与え続ける」という姿勢を、当グループ全体でグローバルに共有するとともに、その共有した価値・姿勢を具現化する事業活動を展開することで、他社・他企業グループとの差別化を図り、HITACHIブランドを高めるための具体的計画を策定し、実行しています。

#### (2) ブランド価値測定並びに向上施策の実施

ブランド価値の測定結果をもとに、HITACHIブランドの価値向上に向けた各種戦略の立案と実践を行っています。たとえば、情報・通信事業グループでは、自事業のブランド価値測定結果を基に、事業とブランドの課題、そして、めざすべきポジショニングを分析し、それを可能とする事業戦略立案とともに、HITACHIブランドの価値向上に向けた各種施策を展開しようとしています。

#### (3) グループ連結経営に基づく情報発信、視覚表現の統一

グループ連結経営の考え方にに基づき、マネジメント連結会社（シナジー追求の観点より戦略

立案や事業運営を当社と行う会社)、ビジョン連結会社(当グループの一員として経営ビジョン、ブランドを共有しつつ、原則としてグループ会社にて事業を主導する会社)、財務連結会社という「連結区分」に照らし、ブランドの表現方法も、2003年4月より、①「Inspire the Next」を前面に当社と一体となり一貫した情報発信を行うグループ、②独自ブランドとともに当グループとしての一体性を表現するグループ、③独自のブランドを掲げるグループの3つに整理し、従来以上に当グループとして統一感あるブランドによる情報発信を行っています。

#### (4) Web マネジメントの推進

近年、ブランドへの影響力が大きいWebサイトは、海外を含め、当グループが一貫した方向性を持って情報発信を行うようマネジメントを強化しています。具体的には当グループをブランドの表現方法に基づき3つのグループに分け、それぞれに守るべき規準を定めています。またWebマネジメント推進のための組織化をグローバルに構築し、責任体制を明確にしています。情報共有のための会議開催や品質向上のための各種Web教育を実施し、真にお客様に価値のあるWebサイトにしていきます。なお、このような取り組みの結果、Webサイトの使いやすさを評価した「企業サイトユーザビリティランキング」(日経パソコン2004.3.29号)で日立のWebサイトは114社中、第2位に評価されています。



#### (5) グローバル化への対応

ビジネスのグローバル化に伴い、海外においても、HITACHIブランドの認知度と価値を高めることが急務となっています。先行する欧州では、顧客インタビューやマネジメントインタビューを実施し、現地におけるHITACHIブランドのポジショニングやめざすべき方向性を分析し、全社員一丸となったブランド価値向上の施策を展開しています。

#### (6) グループ社員一丸となったブランドマネジメントの実施

ブランドの重要性やグループ連結経営における役割に関する理解促進をめざした幹部研修

を実施しています。

また、ブランドマネジメントに対する当グループ共通の理解促進のため、「ブランドマネジメントガイド」を作成し、グループ全体で展開しています。

#### (7) 表彰制度「Inspiration of the Year 賞」の実施

HITACHIブランドを高めた個人、グループを表彰する「Inspiration of the Year 賞」(株価連動型表彰制度)を導入し、募集した結果、国内、海外から総計200件の応募を得ました。

<2002年 Inspiration of the Year 賞の受賞案件 (3件) >

##### ① プラズマテレビ (Wooo) 2002年ワールドワイド展開によるシェア No.1 の獲得

新しいデバイスであるプラズマの性能向上にワールドワイドで先行し、高画質・ハイビジョン対応を実現して、プラズマテレビの需要拡大をけん引した。世界シェア No.1「プラズマの日立」をアピールすると共にグッドデザイン賞など市場の評価も高い。

##### ② 対人地雷処理機の開発と納入による日立建機の社会貢献企業としてのイメージアップ

対人地雷処理機は国連や世界各国の NGO などの評価も No.1 であり、油圧ショベルに表記された「HITACHI」は世界各地で「動く広告塔」として HITACHI ブランドの認知度・好感度を高めている。

##### ③ ミューチップ応用ソリューション事業の立ち上げと推進

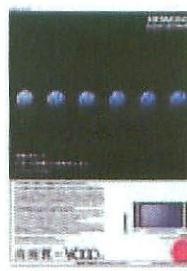
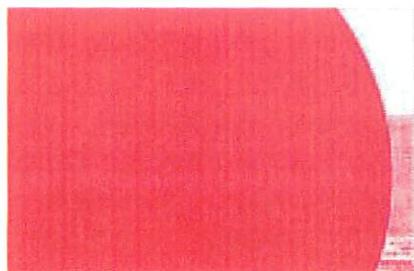
「2003 年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞(日本経済新聞賞)」(日本経済新聞社主催)や「2003 年日刊工業新聞十大新製品賞増田賞(最優秀賞)」(日刊工業新聞主催)などを受賞し、社会の評価も高い(巻末の参考 3 参照)。

その他、卓越したプロダクトブランドの案出・使用・育成者を対象とする表彰(知的財産権賞 商標部門)の制度を有しています。

#### (8) 戦略 IT 広告の実施(「Next MADE IN JAPAN」広告キャンペーン)

HITACHI ブランドに IT・デジタル事業分野を想起させるブランド価値形成、および IT・デジタル事業分野の業績向上を目的とした広告活動「Next MADE IN JAPAN」キャンペーンをスタートさせています。

IT・デジタル事業分野におけるブランド価値を向上させるため、IT 活用の新規事業をテーマにした企業広告や IT・デジタル事業分野の製品広告を積極的に実施するとともに、それらのメッセージに一貫性をもたせ、広告表現でも統一を図り、広告間のシナジーを発揮させるよう取り組んでいます。



参考 1. 日米特許データ対象グループ会社リスト

部門	会社名
情報通信システム	(株)日立コミュニケーションテクノロジー、日立電子サービス(株)、(株)日立情報システムズ、日立ソフトウェアエンジニアリング(株)、(株)日立システムアンドサービス、OPNEXT Inc.、(株)日立ハイコス、日立公共システムエンジニアリング(株)、日立ハイブリッドネットワーク(株)、(株)日立インフォメーションテクノロジー、Hitachi Global Storage Technologies, Inc.、Hitachi Data Systems Holding Corp.
電子デバイス	(株)日立ディスプレイズ、日立電子エンジニアリング(株)[2004/4より(株)日立ハイテクテクノロジーズのグループ会社]、(株)日立ハイテクノロジーズ、(株)日立メトロ、(株)日立超LSIシステムズ、(株)アキタ電子システムズ、日立サイエンスシステムズ
電力・産業システム	バブコック日立(株)、(株)日立空調システム、(株)日立ビルシステム、日立建機(株)、日立エンジニアリング(株)、(株)日立エンジニアリングサービス、(株)日立産機システム、(株)日立インダストリアルズ、日立機電工業(株)、日立プラント建設(株)、(株)日立エシオオートモティブ[2004/10当社へ合併予定]、日立ビーマカニクス(株)、日本サーボ(株)、日立笠戸エンジニアリング(株)、日立水戸エンジニアリング(株)、(株)日立カーエンジニアリング、(株)サナガイ・インフォマティクス、(株)エイチ・シー・エックス
デジタルメディア・民生機器	(株)日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション、日立マクセル(株)、(株)日立メディアエレクトロニクス、日立プリンティングソリューションズ(株)[2004/10(株)リコー殿へ譲渡予定]、(株)日立アドバンスデジタル、(株)日立エルジーデータストレージ、(株)日立ホームテック、日立ライティング(株)、日立多賀テクノロジー(株)
高機能材料	日立電線(株)、日立化成工業(株)、日立金属(株)
物流及びサービス他	(株)日立モバイル、(株)日立物流、HITACHI AMERICA, LTD
金融サービス	日立キャピタル(株)

(以上 53 社)

参考 2. 「特許行政年次報告書 2003 年版」 抜粋

「特許行政年次報告書 2003年版」  
 第3部 我が国における知的財産活動の状況  
 第1章 知的財産戦略と産業競争力  
 4. 知的財産エクセレント・カンパニーの一部より抜粋

企業における知的財産の取得・管理の実施例

〔(株)日立製作所の場合〕

同社においては、知的財産を企業活動のエンジンとして位置付け、発明の発掘・創生、活用に戦略的に取り組んでいる。また、「他社も使わざるを得ない戦略特許を取得」という明確な方針を掲げ、研究開発部門と知的財産部門とが一体となって発明の出願前ブラッシュアップを図った上で権利を取得し、さらに、取得した権利を、知的財産の技術料収益への貢献、クロスライセンスへの活用、独占排他的活用の3つの役割に応じて効果的に活用している。

### 参考 3. 主要社外表彰

- 平成 15 年度 紫綬褒章： 神原秀記フェロー (株)日立製作所  
「蛍光式 DNA シーケンサーの開発」
  
- 平成 15 年度文部科学大臣賞 科学技術功労者賞：藤澤浩道技師長 (株)日立製作所  
「文書イメージ認識と文書情報システムに関する研究」
  
- 第 50 回大河内賞 (大河内記念会主催)：
  - ・ 記念賞「近赤外光を用いた脳活動の画像計測法—光トポグラフィーの開発と実用化」  
(株)日立製作所及び(株)日立メディコ
  
- 第 35 回市村産業賞 (新技術開発財団主催)：
  - ・ 貢献賞「Si-MOS FET を用いた移動体通信用高周波電力増幅器モジュールの開発と実用化」  
(株)日立製作所/半導体事業部 (現・(株)ルネサステクノロジ)
  
- 平成 15 年度全国発明表彰 (発明協会主催)：
  - ・ 内閣総理大臣発明賞：「異方導電フィルム (ACF)」 (特許第 1882895 号) 日立化成工業 (株)
  - ・ 発明賞：「摩擦攪拌接合」 (特許第 3014654 号) (株)日立製作所
  
- 第 46 回十大新製品賞 (日刊工業新聞社主催)：
  - ・ 増田賞「アンテナ内蔵型非接触 IC チップ『ミューチップ』」 (株)日立製作所
  
- 第 1 回新機械振興賞 (機械振興協会主催)：
  - 「平面アンテナ型 UHF 波プラズマエッチャーの開発」  
(株)日立製作所及び(株)日立ハイテクノロジーズ
  
- 第 33 回機械工業デザイン賞 (日本工業新聞主催)：
  - ・ 審査委員会特別賞「磁気共鳴イメージング装置」 (株)日立メディコ
  
- 第 23 回精密工学会賞 (精密工学会主催)：
  - ・ 技術賞「投射電子線磁界トモグラフィ装置の開発」 (株)日立製作所
  
- 2003 年日経優秀製品・サービス賞
  - ・ 最優秀賞 日本経済新聞賞：「IC チップ『ミューチップ』」 (株)日立製作所
  
- 2003 年度朝日賞：「高速 DNA 解読装置の開発」 神原秀記フェロー (株)日立製作所
  
- 2004 年日経 B P 技術賞大賞：
  - 「光トポグラフィーを利用した脳の活動状態を測定する手法の開発と研究」  
(株)日立製作所及び(株)日立メディコ

当社概要 (2004年3月31日現在)

商号：株式会社 日立製作所 Hitachi, Ltd.

設立年月日：1920年2月1日 (創業1910年)

本店所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

代表者：執行役社長 庄山悦彦

主要財務データ：

	2004年3月期 連結	前期比
売上高	86,324億円	105%
営業利益	1,848億円	121%
税引前 当期純利益	2,371億円	245%
少数株主持分 控除前利益	384億円	87%
当期純利益	158億円	57%

国内・海外売上高の概況：

	2004年3月期 連結	前期比
国内売上高	56,548億円	102%
海外売上高	29,775億円	113%
うちアジア	12,128億円	119%
うち北米	8,732億円	98%
うち欧州	6,558億円	122%
その他の地域	2,356億円	118%

# HITACHI

## Inspire the Next

本報告書は、当社有価証券の購入や売却などの勧誘を目的とするものではありません。万一、本報告書に掲載された情報に基づき投資判断等を行い読者において損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。本報告書に記載されている、当社の計画、方針、戦略、事実認識等、将来に関する記述をはじめとする、すでに実現した事実以外の事項は、当社が現在入手している情報に基づく予測、想定、計画等を基礎としています。また、予測には、すでに実現した事実以外に、一定の前提（技術や需要の動向、競合状況、経営環境、為替レートなど）に基づいており、客観性、正確性、実現の確実性を保証するものではありません。また、経営戦略上開示が不適当と判断される内容、将来の不確実性が高いと判断される内容については記載を控えているほか、必ずしも最新の情報を掲載・反映しているものではありません。

お問合せ先

 株式会社 日立製作所 知的財産権本部

〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

(新丸の内ビル8階)

TEL: 03-3212-1111 (代表)

FAX: 03-3214-3110

E-mail: [chizaihokoku@hq.ipg.hitachi.co.jp](mailto:chizaihokoku@hq.ipg.hitachi.co.jp)

(C)Hitachi, Ltd. 2004 (禁無断転載)